# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-184512

(43)Date of publication of application: 02.07.2004

(51)Int.Cl.

G03G 15/08 CO8K 5/42 CO8L101/06 F16C 13/00

(21)Application number: 2002-348350

(71)Applicant : TOKAI RUBBER IND LTD

(22)Date of filing:

29.11.2002

(72)Inventor: YOSHIKAWA HITOSHI

IINUMA KAKUO

# (54) SEMICONDUCTIVE COMPOSITION FOR ELECTROPHOTOGRAPHIC EQUIPMENT MEMBER, AND ELECTROPHOTOGRAPHIC EQUIPMENT MEMBER USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductive composition for an electrophotographic equipment member having small increase of electric resistance at a high voltage region, and having both excellent characteristics of voltage dependency of the electric resistance and environment dependency of the electric resistance.

SOLUTION: The semiconductive composition for the electrophotographic equipment member makes the following (A) and (B) essential components. In the semiconductive composition, a surfactant used for forming a surfactant structure of (A) has a sulfonic acid group in a molecular structure, and a binder polymer of (B) has at least one of the sulfonic acid group and a sulfonic acid metal salt structure in the molecular structure. Here, (A) is the conductive polymer having the surfactant structure, and (B) is the binder polymer.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.12.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19) 日本国特許厅(JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-184512 (P2004-184512A)

(43) 公開日 平成16年7月2日 (2004.7.2)

		(13) APGH 1 (1111
(51) Int.Cl. <sup>7</sup> GO3G 15/08 CO8K 5/42 CO8L 101/06 F16C 13/00	F1 G03G C08K C08L F16C F16C	5/42 3 J 1 O 3 101/06 4 J O O 2
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2002-348350 (P2002-348350) 平成14年11月29日 (2002.11.29)	(71) 出願人 000219602 東海ゴム工業株式会社 愛知県小牧市東三丁目1番地 (74) 代理人 100079382 弁理士 西藤 征彦 (72) 発明者 吉川 均 愛知県小牧市東三丁目1番地 東海ゴム工 業株式会社内 (72) 発明者 飯沼 角王 愛知県小牧市東三丁目1番地 東海ゴム工 業株式会社内 Fターム(参考) 2H077 AD06 DB14 FA13 FA16 FA22 FA25 GA02

(54) 【発明の名称】電子写真機器部材用半導電性組成物およびそれを用いた電子写真機器部材

### (57)【要約】

【課題】高電圧領域での電気抵抗の上昇が小さく、しかも電気抵抗の電圧依存性および電 気抵抗の環境依存性の双方の特性に優れた、電子写真機器部材用半導電性組成物を提供す

【解決手段】下記の(A)および(B)を必須成分とする電子写真機器部材用半導電性組 成物であって、(A)の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、分子 構造中にスルホン酸基を有するとともに、(B)のバインダーポリマーが、分子構造中に 、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方を有する電子写真機器部材 用半導電性組成物である。

- (A) 界面活性剤構造を有する導電性ポリマー。
- (B) バインダーポリマー。

【選択図】なし

# 【特許請求の範囲】

下記の(A)および(B)を必須成分とする電子写真機器部材用半導電性組成物であって (A)の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、分子構造中にスル ホン酸基を有するとともに、(B)のバインダーポリマーが、分子構造中に、スルホン酸 基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方を有することを特徴とする電子写真機器 部材用半導電性組成物。(A)界面活性剤構造を有する導電性ポリマー。

(B) バインダーポリマー。

### 【請求項2】

(B) のバインダーポリマーが、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリ イミド系樹脂、エポキシ系樹脂、ウレア系樹脂、ゴム系ポリマー、および熱可塑性エラス トマーからなる群から選ばれた少なくとも一つである請求項1記載の電子写真機器部材用 半導電性組成物。

### 【請求項3】

(B) のバインダーポリマー中における、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少 なくとも一方の含有量が、 0. 001~1mmo1/gの範囲内である請求項1または 2 記載の電子写真機器部材用半導電性組成物。

(A) の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、分子構造中にスルホ 【請求項4】 ン酸基を有し、かつ、ナフタレン構造およびアントラセン構造の少なくとも一方を有する ものである請求項1~3のいずれか一項に記載の電子写真機器部材用半導電性組成物。

界面活性剤の分子構造中にあるナフタレン構造またはアントラセン構造が、1~9個のう ちの任意の数の置換基を有し、前記の置換基が水素、アルキル基、アルケニル基、アルコ キシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アリール基、アルキルアリール基、 アリールアルキル基、アルキルスルフィニル基、アルコキシアルキル基、アリールオキシ アルキル基、ナフチル基、ナフチルアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコキシカル ボニル基、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基およびハロゲンからな る群から選ばれている請求項4記載の電子写真機器部材用半導電性組成物。

# 【請求項6】

(A) の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、下記の一般式 (1) で表されるものである請求項1~3のいずれか一項に記載の電子写真機器部材用半導電性 組成物。

30

20

【化1】

$$(R^2)$$
 $(C-O-CH_2 CH_2 OCH_2 CH_2 OR^1)$ 
 $(R^3)$ 
 $(R^3)$ 
 $(C-O-CH_2 CH_2 OCH_2 CH_2 OR^1)$ 
 $(R^3)$ 
 $(R^3)$ 

〔式中、R¹は水素、または炭素数1~15のアルキル基、アルケニル基、アル キルチオアルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、 アルコキシアルキル基、アリールオキシアルキル基を示し、複数存在する場合は 互いに同一または異なっていてもよい。また、R²は、水素、アルキル基、アル ケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アリール 基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、アルキルスルフィニル基、アル コキシアルキル基、アリールオキシアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコ キシカルボニル基、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基また はハロゲンを示し、複数存在する場合は互いに同一または異なっていてもよい。 また、nは $1\sim5$ の整数を示し、mは $0\sim4$ の整数を示し、n+m=5である。 }

【請求項7】

(A) の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、下記の一般式 (2) で表されるものである請求項1~5のいずれか一項に記載の電子写真機器部材用半導電性 組成物。

10

【化2】

$$(R^3)$$
 q  $(R^4)$  r  $(R^4)$  r  $(R^3)$   $(R^4)$  r  $(R^4)$ 

〔式中、R³ およびR⁴ は、それぞれ水素、アルキル基、アルケニル基、アルコ キシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アリール基、アルキルアリ ール基、アリールアルキル基、アルキルスルフィニル基、アルコキシアルキル基 、アリールオキシアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコキシカルボニル基 、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基またはハロゲンを示し 、複数存在する場合は互いに同一または異なっていてもよい。Mは、一価のカチ オン (プロトンを除く) を示す。また、qおよび r は、それぞれ 1 ~ 6 の整数を 示す。〕

20

10

### 【請求項8】

(A) の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤中のスルホン酸基当量が 3 4 0 ~ 6 0 0 の範囲内である請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の電子写真機器部材 用半導電性組成物。

### 【請求項9】

請求項1~8のいずれか一項に記載の電子写真機器部材用半導電性組成物を、電子写真機 器部材の少なくとも一部に用いたことを特徴とする電子写真機器部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

30

本発明は、電子写真機器部材用半導電性組成物およびそれを用いた電子写真機器部材に関 するものであり、詳しくは現像ロール等の電子写真機器部材に用いられる半導電性組成物 およびそれを用いた電子写真機器部材に関するものである。

[0002]

### 【従来の技術】

一般に、現像ロール等の電子写真機器部材に用いられる導電性組成物は、好適に使用する ためには電気抵抗の制御が必須である。そのため、従来は、樹脂やゴム等のバインダーポ リマーに、第四級アンモニウム塩等のイオン導電剤や、カーボンブラック等の電子導電剤 を配合することにより、電気抵抗の制御を行っていた。

[0003]

40

上記導電剤のうち、このイオン導電剤は、バインダーポリマーに溶解するため、導電性の ばらつきが小さく、また電圧を変化させた時の電気抵抗の変動が小さく、電気抵抗の電圧 依存性に優れるという利点がある。しかし、イオン導電剤は水分等の影響を受けやすく、 高温高湿と低温低湿の条件下では電気抵抗が2桁以上変動するため、電気抵抗の環境依存 性に劣り、電子写真機器部材としての使用には制約が多い。一方、カーボンブラック等の 電子導電剤は、水分等の影響を受けにくく、高温高湿と低温低湿の条件下での電気抵抗の 変動が小さいため、電気抵抗の環境依存性に優れているという利点がある。しかし、電子 導電剤は、一般に、凝集性が強いため、バインダーポリマー中での均一分散が困難であり 、したがって、電気抵抗のぼらつきが大きく、導電性の制御が困難である。また、比較的 均一に分散している場合でも、導電性発現のメカニズムがバインダーポリマー中のカーボ

20

30

40

50

ン間を、電子が高電圧により伝わるトンネル効果もしくはホッピング現象によるものであるため、電圧を変化させた時の電気抵抗の変動が大きく、電気抵抗の電圧依存性に劣る。

[0004]

これらの問題を解決するため、従来、ポリウレタンロール表面に、ポリアニリンとナイロ ンの複合体を固定したロール状の帯電部材(特許文献1参照)や、π電子共役系導電性高 分子、樹脂成分および溶剤を含む帯電防止膜形成用組成物(特許文献2参照)が提案され ている。また、組成材料中に、電子導電性を付与する導電剤と、ポリアニリン等の導電性 ポリマーとを含有する中間転写体(特許文献3参照)や、酸性基を有する水溶性ポリアニ リンと、水溶性高分子化合物または水系エマルジョン形成高分子化合物からなる水系高分 子化合物とを含有する半導電性部材(特許文献4参照)が提案されている。しかしながら 、特許文献 1 では、導電性ポリマーであるポリアニリンと、ナイロンの相溶性が悪く、1 μm以上の粒として凝集した組成物となっているため、電気抵抗の初期特性、電気抵抗の 電圧依存性に劣り、特許文献 2 では、π電子共役系導電性高分子と、樹脂成分との相溶性 が悪いために、電気抵抗の電圧依存性に劣る。また、特許文献3では、ポリアニリン等の 導電性ポリマーが、電子導電性を付与する導電剤とのブレンド時に、脱ドープが必須で、 その場合もN-メチルー2-ピロリドン(NMP)という特殊溶剤にしか溶解しないため 、電子導電性を付与する導電剤と、導電性ポリマーとのブレンドが非常に困難である。ま た、塗膜形成後に酸化処理が必要であり、均一な制御が難しく、工程も煩雑である。特許 文献4では、酸性基を有する水溶性ポリアニリンが水溶性であるため、製品への塗布時に ハジキや塗布ムラが発生したり、湿熱条件で放置した場合の経時変化が大きく、電子写真 機器部材としての使用には制約が大きい。

[00005]

これらの問題を解決すべく、本発明者らは、界面活性剤構造を有する導電性ポリマーと、 バインダーポリマーとを必須成分とする導電性組成物について、すでに特許出願を行って いる(特許文献 5 参照)。

[0006]

【特許文献1】

特開平5-88506号公報

【特許文献2】

特開平9-48921号公報

【特許文献3】

特開2001-324882号公報

【特許文献4】

特開2002-89543号公報

【特許文献5】

特開2002-167519号公報

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本発明者らは、特許文献 5 に記載の導電性組成物について、さらに検討を重ねた結果、このものは、水との親和性は良いが、溶剤への溶解性が悪いため、界面活性 剤構造を有する導電性ポリマーと、バインダーポリマーとの相溶性が若干劣って凝集物が 発生し、そのため、高電圧領域で電気抵抗の上昇傾向がみられることを突き止めた。

[0008]

本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、高電圧領域での電気抵抗の上昇が小さく、しかも電気抵抗の電圧依存性および電気抵抗の環境依存性の双方の特性に優れた、電子写真機器部材用半導電性組成物およびそれを用いた電子写真機器部材の提供をその目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するため、本発明は、下記の(A)および(B)を必須成分とする電子

写真機器部材用半導電性組成物であって、(A)の界面活性剤構造を形成するために用い られる界面活性剤が、分子構造中にスルホン酸基を有するとともに、(B)のバインダー ポリマーが、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方 を有する電子写真機器部材用半導電性組成物を第1の要旨とし、この電子写真機器部材用 半導電性組成物を、電子写真機器部材の少なくとも一部に用いた電子写真機器部材を第2 の要旨とする。

(A) 界面活性剤構造を有する導電性ポリマー。

(B) バインダーポリマー。

### [0010]

すなわち、本発明者らは、高電圧領域での電気抵抗の上昇が小さく、しかも電気抵抗の電 圧依存性および電気抵抗の環境依存性の双方の特性に優れた、半導電性組成物を得るべく 、鋭意研究を重ねた。その結果、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤を用いて 、界面活性剤構造を有する導電性ポリマーを形成し、この導電性ポリマーとともに、分子 構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方を有するバインダ ーポリマーを併用すると、両者の相溶性が良好となって凝集物の発生を抑制できるため、 高電圧領域での電気抵抗の上昇が小さくなり、所期の目的を達成できることを見いだし、 本発明に到達した。

### [0011]

# 【発明の実施の形態】

つぎに、本発明の実施の形態について説明する。

### [0012]

本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物は、界面活性剤構造を有する導電性ポリマー (A成分)と、バインダーポリマー (B成分)とを用いて得ることができる。

本発明においては、界面活性剤構造を有する導電性ポリマー(A成分)の界面活性剤構造 を形成するために用いられる界面活性剤が、分子構造中にスルホン酸基(-SO₃ を有するとともに、バインダーポリマー(B成分)が、分子構造中に、スルホン酸基およ びスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方を有しているのであり、これが最大の特徴であ

### [0014]

この界面活性剤構造を有する導電性ポリマー(A成分)は、例えば、導電性ポリマーの原 料モノマーと、特定の界面活性剤とを、酸化剤の存在下に、水中で酸化重合させる等の化 学酸化重合法等によって製造することができる。

このような導電性ポリマーの原料モノマーとしては、重合体がドーピングにより導電性を 有するものであれば特に限定はなく、例えば、アニリン(アニリン誘導体の他、アニリン 塩酸塩等のアニリン塩も含む)、ピロール、チオフェン、アルキルチオフェン、エチレン ジオキシチオフェン、イソナフトチオフェン、3 - チオフェン-β-エタンスルホン酸、 ジチェノチオフェン、アセチレン、パラフェニレン、フェニンビニレン、フラン、セレノ フェン、テルロフェン、イソチアナフテン、パラフェニレンスルフィド、パラフェニレン オキシド、ビニレンスルフィド等が挙げられる。

# [0016]

特定の界面活性剤としては、分子構造中に、スルホン酸基を有するものであれば特に限定 はなく、例えば、下記の一般式(1)または(2)で表されるものがあげられる。

[0017]

### 【化3】

20

10

30

20

30

40

$$(R^{2}) \xrightarrow{\mathbb{D}} (C-O-CH_{2} CH_{2} OCH_{2} CH_{2} OR^{1})$$

$$SO_{3} H \qquad \cdots (1)$$

〔式中、R¹は水素、または炭素数1~15のアルキル基、アルケニル基、アル キルチオアルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、 アルコキシアルキル基、アリールオキシアルキル基を示し、複数存在する場合は 互いに同一または異なっていてもよい。また、R°は、水素、アルキル基、アル ケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アリール 基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、アルキルスルフィニル基、アル コキシアルキル基、アリールオキシアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコ キシカルボニル基、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基また はハロゲンを示し、複数存在する場合は互いに同一または異なっていてもよい。 また、nは $1\sim5$ の整数を示し、mは $0\sim4$ の整数を示し、n+m=5である。 )

[0018] 【化4】

$$(R^3)_q$$
 $MO_3S$ 
 $(R^4)_r$ 
 $SO_3H$ 
 $\cdots$  (2)

〔式中、R³ およびR¹ は、それぞれ水素、アルキル基、アルケニル基、アルコ キシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アリール基、アルキルアリ ール基、アリールアルキル基、アルキルスルフィニル基、アルコキシアルキル基 、アリールオキシアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコキシカルボニル基 、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基またはハロゲンを示し 、複数存在する場合は互いに同一または異なっていてもよい。Mは、一価のカチ オン (プロトンを除く) を示す。また、qおよび r は、それぞれ 1 ~ 6 の整数を 示す。〕

[0019]

一般式 (1) において、好ましい R¹ としては、炭素数 2 ~ 1 2 のアルキル基等があげ られる。また、R<sup>2</sup> としては、水素、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ア ルキルチオアルキル基、アリール基、アルキルスルフィニル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基が好ましく、さら に好ましくは、水素、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アルキ ルスルフィニル基、アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、 ニトリル基、ヒドロキシ基である。また、 n は 2 ~ 4 の整数が好ましい。

[0020]

および R⁴ としては、水素、アルキル基 また、一般式 (2) において、好ましい R<sup>3</sup> 、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アルキルスルフィニル基、 アルコキシアルキル基、アリールオキシアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコキシ カルボニル基、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基またはハロゲンが あげられる。一般式 (2) における好ましいMとしては、ナトリウムイオン、カリウムイ オン、アンモニウムイオンがあげられる。

10

[0021]

特に、上記特定の界面活性剤としては、分子構造中にスルホン酸基を有し、かつ、ナフタ レン構造およびアントラセン構造の少なくとも一方を有するものが特に好ましい。

また、ナフタレン構造およびアントラセン構造は、1~9個のうちの任意の数の置換基を 有するものが好ましい。この置換基としては、例えば、水素、アルキル基、アルケニル基 、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルチオアルキル基、アリール基、アルキルアリ ール基、アリールアルキル基、アルキルスルフィニル基、アルコキシアルキル基、アリー ルオキシアルキル基、ナフチル基、ナフチルアルキル基、アルキルスルホニル基、アルコ キシカルボニル基、カルボキシル基、ニトリル基、ヒドロキシ基、ニトロ基、ハロゲン等 があげられる。これら置換基は、単独で置換されていてもよいし、2種以上が置換されて いてもよい。

[0023]

このような特定の界面活性剤中のスルホン酸基当量は、340~600の範囲内が好まし く、特に好ましくは380~550の範囲内である。すなわち、スルホン酸基当量が34 O 未満であると、バインダーポリマー (B 成分)との相溶性が悪くなる傾向がみられ、逆 に600を超えると、ドーパントとしての効果が減少する傾向がみられるからである。こ のスルホン酸基当量は、水酸化ナトリウムの滴定や熱重量分析法(TGA)に従って求め られる。

[0024]

前記の化学酸化重合法に用いる酸化剤としては、特に限定はないが、例えば、過硫酸アン モニウム(APS)、過酸化水素水、塩化第二鉄等があげられる。

[0025]

導電性ポリマーの原料モノマーと、特定の界面活性剤との混合比は、モル比で、原料モノ マー/界面活性剤=1/0.03~1/3の範囲内が好ましく、特に好ましくは原料モノ マー/界面活性剤=1/0.05~1/2の範囲内である。すなわち、界面活性剤のモル 比が低くなると、バインダーポリマー(B成分)との相溶性や分散性が低下する傾向がみ られ、逆に界面活性剤のモル比が高くなると、界面活性剤の、イオン導電性への寄与効果 が強くなりすぎ、導電性ポリマーの電子導電性を減らす傾向がみられるからである。

このようにして得られる特定の導電性ポリマー ( A 成分) の数平均分子量 ( M n ) は、 l , 000~100, 000の範囲内が好ましく、特に好ましくは1, 000~20, 00 0の範囲内である。

[0027]

つぎに、上記特定の導電性ポリマー(A成分)とともに用いられるバインダーポリマー( B成分)としては、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくと も一方を有するものであれば特に限定はない。このスルホン酸金属塩構造としては、例え ば、スルホン酸ナトリウム塩構造、スルホン酸アンモニウム塩構造、スルホン酸カリウム

塩構造等があげられる。

### [0028]

このような、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方 を有するバインダーポリマー(B成分)としては、例えば、そのような構造を有する、ア クリル系樹脂、ウレタン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂、ウ レア系樹脂、ゴム系ポリマー、熱可塑性エラストマー等があげられる。これらは単独でも しくは2種以上併せて用いられる。これらのなかでも、特定の導電性ポリマー(A成分) との相溶性に優れる点で、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ゴム系ポリマー、熱可塑性 エラストマーが好適に用いられる。

### [0029]

また、アクリル系樹脂としては、例えば、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリ エチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリエチルアクリレート、ポリブチル アクリレート、ポリヒドロキシメタクリレート、アクリルシリコーン系樹脂、アクリルフ ッ素系樹脂、公知のアクリルモノマーを共重合したもの等であって、分子構造中に、スル ホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方が導入されているものがあげられ る。バインダーポリマーへのスルホン酸基導入の方法は、スルホン酸基またはスルホン酸 金属塩基を有するビニルモノマーと、ラジカル、アニオン、カチオン共重合する方法や、 スルホン酸基を有するジオールモノマーを、ウレタン反応、エステル交換反応で導入する 方法がある。

# [0030]

また、ウレタン系樹脂としては、分子構造中にウレタン結合を有する樹脂であれば特に限 定はなく、例えば、エーテル系、エステル系、アクリル系、脂肪族系等のウレタンや、そ れにシリコーン系ポリオールまたはフッ素系ポリオールを共重合させたもの等であって、 分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方が導入されて いるものがあげられる。なお、ウレタン系樹脂は、分子構造中にウレア結合またはイミド 結合を有するものであってもよい。

### [0031]

また、フッ素系樹脂としては、例えば、ポリビニリデンフルオライド(PVDF)、フッ 化ビニリデン-四フッ化エチレン共重合体、フッ化ビニリデン-四フッ化エチレン-六フ ッ化プロピレン共重合体等であって、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属 塩構造の少なくとも一方が導入されているものがあげられる。

# [0032]

また、ポリイミド系樹脂としては、例えば、ポリアミドイミド(PAI)、ポリアミック 酸、シリコーンイミド等であって、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩 構造の少なくとも一方が導入されているものがあげられる。

### [0033]

また、エポキシ系樹脂としては、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、エポキシノ ボラック樹脂、臭素化型エポキシ樹脂、ポリグリコール型エポキシ樹脂、ポリアミド併用 型エポキシ樹脂、シリコーン変性エポキシ樹脂、アミノ樹脂併用型エポキシ樹脂、アルキ ッド樹脂併用型エポキシ樹脂等であって、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸 金属塩構造の少なくとも一方が導入されているものがあげられる。

### [0034]

また、ウレア系樹脂としては、分子構造中にウレア結合を有する樹脂であれば特に限定は なく、ウレタンウレアエラストマー、メラミン樹脂、尿素ホルムアルデヒド樹脂等であっ て、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方が導入さ れているものがあげられる。

### [0035]

また、ゴム系ポリマーとしては、例えば、天然ゴム(NR)、ブタジエンゴム(BR)、 アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、水素添加NBR(H-NBR)、スチレン ブタジエンゴム (SBR)、イソプレンゴム(IR)、ウレタンゴム、クロロプレンゴム

10

20

40

30

50

(CR)、塩素化ポリエチレン (CI-PE)、エピクロロヒドリンゴム (ECO, CO )、ブチルゴム(IIR)、エチレンプロピレンジエンポリマー(EPDM)、フッ素ゴ ム等であって、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一 方が導入されているものがあげられる。

# [0036]

また、熱可塑性エラストマーとしては、例えば、スチレンーブタジエンブロック共重合体 (SBS), スチレンーエチレンーブチレンースチレンブロック共重合体 (SEBS)等 のスチレン系熱可塑性エラストマー、ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)、オレ フィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TP E E)、ポリアミド系熱可塑性エラストマー、フッ素系熱可塑性エラストマー、塩ビ系熱 可塑性エラストマー等であって、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構 造の少なくとも一方が導入されているものがあげられる。これらは単独でもしくは2種以 上併せて用いられる。これらのなかでも、合成プロセスの簡便さ、溶剤との溶解性の点で 、TPUが好適に用いられる。

### [0037]

このバインダーポリマー(B成分)中における、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構 造の少なくとも一方の含有量(スルホン酸基量)は、0.001~1mmol/gの範囲 内が好ましく、特に好ましくは O. O 1 ~ O. 2 m m o 1 / g の範囲内である。すなわち 、このスルホン酸基量が0.001mmol/g未満であると、特定の導電性ポリマー( A成分)との相溶性が悪くなる傾向がみられ、逆に1mmol/gを超えると、含水によ る物性の低下やイオン導電性の発現がみられるからである。

### [0038]

このような特定のバインダーポリマー (B成分)の数平均分子量 (Mn)は、500~2 , 000, 000の範囲内が好ましく、特に好ましくは2, 000~800, 000の範 囲内である。

上記特定のバインダーポリマー(B成分)と、特定の導電性ポリマー(A成分)とは、後 記のようにして混合され半導電性組成物化されるが、上記特定の導電性ポリマー(A成分 )の原料(導電性ポリマーの原料モノマーと、界面活性剤との合計量)と、特定のバイン ダーポリマー (B成分) との混合比は、重量比で、A成分の原料/B成分=1/99~4 0 / 6 0 の範囲が好ましく、特に好ましくは A 成分の原料/ B 成分 = 4 / 9 6 ~ 3 5 / 6 5 である。すなわち、 A 成分の原料の重量比が 1 未満であると、導電性への効果が少なく なる傾向がみられ、逆にA成分の原料の重量比が40を超えると、得られる組成物が固く て脆くなりやすく、組成物としての物性が低下する傾向がみられるからである。

なお、本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物には、特定の導電性ポリマー(A成分 ) および特定のバインダーポリマー (B成分) に加え、場合によって、イオン導電剤、電 子導電剤、架橋剤等を適宜配合しても差し支えない。

このイオン導電剤としては、例えば、過塩素酸リチウム、第四級アンモニウム塩、ホウ酸 塩等のポリマー中でイオン解離する化合物があげられる。これらは単独でもしくは2種以 上併せて用いられる。

[0042]このようなイオン導電剤の配合割合は、物性や電気特性の点から、特定の導電性ポリマー (A成分)の原料(原料モノマーと、界面活性剤との合計量)と、特定のバインダーポリ マー (B成分) との合計 100重量部 (以下「部」と略す) に対して、0.01~5部の 範囲内が好ましく、特に好ましくは 0.5~2部の範囲内である。

また、電子導電剤としては、例えば、カーボンブラック、c-ZnO(導電性酸化亜鉛) [0043]、 c ー T i O<sub>2</sub> (導電性酸化チタン)、 c ー S n O<sub>2</sub> (導電性酸化錫)、グラファイ ト等があげられる。

このような電子導電剤の配合割合は、物性や電気特性の点から、特定の導電性ポリマー( A成分)の原料(原料モノマーと界面活性剤との合計量)と、特定のバインダーポリマー (B成分)との合計 1 0 0 部に対して、 5 ~ 3 0 部の範囲内が好ましく、特に好ましくは 8~20部の範囲内である。

また、架橋剤としては、例えば、硫黄、イソシアネート、ブロックイソシアネート、メラ ミン等の尿素樹脂、エポキシ硬化剤、ポリアミン硬化剤、パーオキサイド等があげられる

10

### [0046]

このような架橋剤の配合割合は、物性、粘着、液保管性の点から、特定の導電性ポリマー (A成分)の原料(原料モノマーと界面活性剤との合計量)と、特定のバインダーポリマ ー (B成分)との合計100部に対して、1~30部の範囲内が好ましく、特に好ましく は3~10部の範囲内である。

### [0047]

なお、本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物には、前記各成分に加えて、架橋促進 剤、老化防止剤等を必要に応じて配合しても差し支えない。

### [0048]

この架橋促進剤としては、例えば、スルフェンアミド系架橋促進剤、ジチオカルバミン酸 20 塩系架橋促進剤等があげられる。

[0049]本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物は、例えば、つぎのようにして調製すること ができる。すなわち、まず、前述の方法に従い、特定の導電性ポリマー(A成分)を作製 する。つぎに、この特定の導電性ポリマー(A成分)に、特定のバインダーポリマー(B 成分)を配合するとともに、必要に応じて、イオン導電剤、電子導電剤、架橋剤等を配合 する。そして、これらをロール、ニーダー、バンバリーミキサー等の混練機を用いて混練 することにより、目的とする半導電性組成物を得ることができる。ここで、上記特定の導 電性ポリマー(A成分)は、溶剤に溶解した状態のものが用いられる。また、バインダー ポリマー(B成分)は、溶剤に溶解した状態で用いられる。

30

### [0050]

この溶剤としては、例えば、m-クレゾール、メタノール、メチルエチルケトン(MEK )、トルエン、テトラヒドロフラン(THF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP) 等の有機溶剤等があげられる。

### [0051]

本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物は、25℃×50%RHの環境下、10Vの 電圧を印加した時の電気抵抗が  $1\ 0^6\ \sim 1\ 0^{1\ 1}\ \Omega$ ・ c m の範囲内であることが好まし く、特に好ましくは  $10^{7}$  ~  $10^{10}$   $\Omega$ ・c m の範囲内である。すなわち、電気抵抗が Ω·cm未満であると、電気抵抗が低すぎるため、トナーへの電荷供給や感光体 への帯電性等の点で、電子写真機器部材として画像への利点が少なくなる傾向がみられ、 逆に10<sup>11</sup> Ω・cmを超えると、電気抵抗が高すぎるため、チャージアップが起こり、 電子写真機器部材としての制御が困難になる傾向がみられるからである。

40

### [0052]

本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物を用いて塗膜を形成した場合、バインダーポ リマー(B成分)中に存在する特定の導電性ポリマー(A成分)の凝集物(1μm以上) が、塗膜全体の面積の3%未満であることが好ましく、特に好ましくは0.5%未満であ る。すなわち、この凝集物が、塗膜全体の面積の3%を超えると、電圧に対する電気抵抗 の変動が大きくなる傾向がみられるからである。

### [0053]

本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物は、電子写真機器部材の少なくとも一部(全

部もしくは一部) に用いられる。この電子写真機器部材としては、例えば、現像ロール, 帯電ロール、転写ロール、トナー供給ロール等の導電性ロール、中間転写ベルト、紙送り ベルト等の導電性ベルト等があげられ、これらの構成層の少なくとも一部に用いられる。 すなわち、本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物を、電子写真機器部材の構成層の 少なくとも一部に用いると、この半導電性組成物を用いて形成した構成層の電気抵抗の電 圧依存性および環境依存性が小さくなる。その結果、他の構成層においても、電気抵抗の 電圧依存性および環境依存性の影響を受けにくくなるため、電子写真機器部材全体として の電気抵抗の電圧依存性および環境依存性が小さくなる。

[0054]

つぎに、実施例について比較例と併せて説明する。

[0055]

まず、本発明に係る組成物を、以下のようにして作製した。

[0056]

【組成物1】

アニリン1molと、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤(ドデシルベンゼン スルホン酸) [スルホン酸基当量:326] 1 m o l とを、水溶液化した酸化剤 (過硫酸 アンモニウム)1molを滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリアニ リン(A成分)を得た。つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポリ マー(B成分)である、TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、スル ホン酸Na基量: 0. 05 m m o l / g) 8 0 部を、溶剤 (M E K) 2 0 0 部および溶剤 (トルエン) 300部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成 分(不揮発分)20部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。 そして、この組成物 (コーティング液) を S U S 3 0 4 板上に塗布して、厚み 1 0 0 μ m の導電性塗膜を作製した。

[0057]

【組成物2】

アニリン1molと、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤(ペンタデシルベン ゼンスルホン酸) 〔スルホン酸基当量:368〕1mo1とを、水溶液化した酸化剤 (過 硫酸アンモニウム)1molを滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリ アニリン(A成分)を得た。つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダー ポリマー (B成分)である、TPU (日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、 スルホン酸 N a 基量: O . O 5 m m o l / g ) 8 O 部を、溶剤 (M E K ) 1 O O 部および 溶剤(トルエン) 5 0 0 部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有 効成分(不揮発分) 2 0 部を加え、1 0 分間攪拌し、組成物 (コーティング液) を調製し た。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚み100 μmの導電性塗膜を作製した。

[0058]

【組成物3】

アニリン 1 molと、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤 (ジノニルナフタレ ンスルホン酸) [スルホン酸基当量:460] 1 m o 1 とを、水溶液化した酸化剤 (過硫 酸アンモニウム)1molを滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリア ニリン(A成分)を得た。つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポ リマー(B成分)である、TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、ス ルホン酸 N a 基量: 0. 0 5 m m o l / g ) 8 0 部を、溶剤 (M E K ) 3 0 0 部および溶 剤(トルエン)300部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効 成分(不揮発分)20部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した 。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚み100μ mの導電性塗膜を作製した。

[0059]

【組成物4】

10

20

30

アニリン1molと、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤(2,2′ージナフ チルメタン-6-スルホン酸ナトリウム-6′-スルホン酸)〔スルホン酸基当量:45 0〕 1 m o 1 とを、水溶液化した酸化剤 (過硫酸アンモニウム) 1 m o 1 を滴下しながら 酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。つぎに、分子構 造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポリマー(B成分)である、TPU(日本ポ リウレタン工業社製、ニッポラン3312、スルホン酸Na基量:0.05mmol/g ) 80部を、溶剤(M E K ) 1 00部および溶剤(トルエン) 5 00部に溶解した後、上 記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分)20部を加え、10分間 攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物(コーティング液) をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0060]

アニリン 1 m o 1 と、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤 (一般式 (1) にお いて、 $R^{-1}$  =ブチル基、 $R^{-2}$  =水素、n=2、m=3で表される化合物)〔スルホン 酸基当量:534〕1mo1とを、水溶液化した酸化剤(過硫酸アンモニウム)1mol を滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポリマー(B成分)である、 TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、スルホン酸Na基量:0.0 5 m m o l / g) 8 0 部とを、溶剤 (M E K) 1 0 0 部および溶剤 (トルエン) 5 0 0 部 に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分) 2 0 部 を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物( コーティング液)をSUS304板上に塗布した後、150℃にて30分間加熱架橋して 、厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0061]

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸 N a 基を有するバインダーポリマー (B 成分) である、 TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、スルホン酸Na基量:0.0 5 m m o l / g) 8 0 部と、ブロックイソシアネート(大日本インキ化学工業社製、バー ノック D B 9 8 0 K ) 5 部とを、溶剤 (M E K ) 2 0 0 部および溶剤(トルエン) 4 0 0 部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分)20 部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物 (コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製 した。

[0062]

ピロール1molと、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤(ペンタデシルベン ゼンスルホン酸)〔スルホン酸基当量:368〕1molとを、水溶液化した酸化剤(過 硫酸アンモニウム)1molを滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリ ピロール(A成分)を得た。つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダー ポリマー(B成分)である、TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、 スルホン酸 N a 基量: 0. 0 5 m m o l / g ) 8 0 部と、ブロックイソシアネート (大日 本インキ化学工業社製、バーノックDB980K)5部とを、溶剤(MEK)200部お よび溶剤(トルエン)400部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリピロール の有効成分(不揮発分)20部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調 製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚み1 OOμmの導電性塗膜を作製した。

[0063]

チオフェン1molと、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤(ペンタデシルベ

ンゼンスルホン酸)〔スルホン酸基当量:368〕1molとを、水溶液化した酸化剤( 過硫酸アンモニウム)1molを滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポ リチオフェン (A成分)を得た。つぎに、分子構造中にスルホン酸 N a 基を有するバイン ダーポリマー(B成分)である、TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン331 2、スルホン酸 N a 基量: 0. 0 5 m m o 1 / g ) 8 0 部と、ブロックイソシアネート( 大日本インキ化学工業社製、バーノックDB980K)5部とを、溶剤(MEK)200 部および溶剤(トルエン)400部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリチオ フェンの有効成分(不揮発分) 2 0 部を加え、1 0 分間攪拌し、組成物 (コーティング液 )を調製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布して、 厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

10

[0064]

【組成物9】

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸基を有するバインダーポリマー(B成分)である、スチ レンスルホン酸の存在下で溶液重合することで合成したスルホン化NBR(スルホン酸基 量: 0 . 1 m m o 1 / g 、 M n : 1 0 0 , 0 0 0 ) 8 0 部と、架橋剤である硫黄 1 部と、 スルフェンアミド系架橋促進剤(大内新興化学工業社製、ノクセラーCZ)0.5部と、 ジチオカルバミン酸塩系架橋促進剤 (大内新興化学工業社製、ノクセラーBZ) 0.5部 とを、2本ロールを用いて混練し、これらを溶剤(MEK)300部および溶剤(トルエ ン)300部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮 発分)20部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、 この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布した後、150℃にて30分間 加熱架橋して、厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0065]

【組成物10】

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸基を有するバインダーポリマー(B成分)である、スル ホン化ウレタンシリコーン (スルホン酸基量: 0. 1 m m o 1 / g、M n: 50, 000 ) 80部と、ブロックイソシアネート(大日本インキ化学工業社製、バーノックDB98 OK) 5 部とを、溶剤 (MEK) 2 O O 部および溶剤 (トルエン) 4 O O 部に溶解した後 、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分)20部を加え、10 分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物(コーティング 液)をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製した。なお、ス ルホン化ウレタンシリコーンは、ポリブチレンアジペートジオール (Mn:2,000) と、シリコーンジオール(Mn:2、000)とを、8:2の割合で混合したものに、鎖 延長剤として、1,4-ブタンジオールおよび1,4-ブタンジオール-2-スルホン酸 ナトリウムを加え、4,4′ージフェニルメタンジイソシアネート (MDI) と等モルで 反応させることにより作製した。

30

20

[0066]

40

【組成物11】 組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸基を有するバインダーポリマー(B成分)である、スル ホン化アクリルフッ素 (スルホン酸基量: 0. 1 m m o 1 / g、M n: 30, 000) 8 0部と、ブロックイソシアネート(大日本インキ化学工業社製、バーノックDB980K ) 5 部とを、溶剤 (M E K ) 2 O O 部および溶剤 (トルエン) 4 O O 部に溶解した後、上 記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分)20部を加え、10分間 攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物(コーティング液) をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0067]

【組成物12】

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸基を有するバインダーポリマー(B成分)である、組成 物10においてスルホン酸基を増量して作製したスルホン化ウレタンシリコーン(スルホ ン酸基量:1 mm o 1 / g、M n : 5 0, 0 0 0 ) 8 0 部と、ブロックイソシアネート( 大日本インキ化学工業社製、バーノックDB980K)5部とを、溶剤(MEK)200 部および溶剤(トルエン)400部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニ リンの有効成分(不揮発分)20部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液) を調製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚 み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0068]

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸基を有するバインダーポリマー(B成分)である、組成 物10においてスルホン酸基を減量して作製したスルホン化ウレタンシリコーン(スルホ ン酸基量: 0. 001 m m o 1 / g、 M n : 50,000) 80部と、ブロックイソシア ネート (大日本インキ化学工業社製、バーノックDB980K) 5部とを、溶剤 (MEK ) 200部および溶剤(トルエン)400部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有する ポリアニリンの有効成分(不揮発分)20部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティ ング液)を調製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布 して、厚み 1 0 0 μ m の 導電性 塗膜を作製した。

[0069]

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポリマー(B成分)である、 TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、スルホン酸Na基量:0.0 5 m m o l / g) 9 0 部と、ブロックイソシアネート (大日本インキ化学工業社製、バー ノックDB980K) 5部とを、溶剤 (MEK) 200部および溶剤 (トルエン) 400 部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分)10 部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物 (コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製 した。

[0070]

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポリマー(B成分)である、 TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、スルホン酸Na基量:0.0 5 mmol/g) 7 0 部と、ブロックイソシアネート (大日本インキ化学工業社製、バー ノック D B 9 8 O K ) 5 部とを、溶剤 (M E K ) 2 O O 部および溶剤 (トルエン) 4 O O 部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分) 3 0 部を加え、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物 (コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製 した。

[0071]

組成物2と同様にして、同様の界面活性剤構造を有するポリアニリン(A成分)を得た。 つぎに、分子構造中にスルホン酸Na基を有するバインダーポリマー(B成分)である、 TPU(日本ポリウレタン工業社製、ニッポラン3312、スルホン酸Na基量:0.0 5 m m o l / g) 8 0 部と、アセチレンブラック(電気化学工業社製、デンカブラックH S100)5部と、ブロックイソシアネート(大日本インキ化学工業社製、バーノックD B 9 8 0 K ) 5 部とを、溶剤 (M E K ) 2 0 0 部および溶剤 (トルエン) 4 0 0 部に溶解

10

20

30

40

した後、上記界面活性剤構造を有するポリアニリンの有効成分(不揮発分)20部を加え 、10分間攪拌し、組成物(コーティング液)を調製した。そして、この組成物(コーテ ィング液)をSUS304板上に塗布して、厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0072]

つぎに、本発明において、比較例となるべき組成物を、以下のようにして作製した。

[0073]

【組成物A】

分子構造中にスルホン酸基を有しないバインダーポリマーである、H-NBR(日本ゼオ ン社製、ゼットポール0020)100部と、イオン導電剤であるホウ酸塩(日本カーリ ット社製、LR147) 2 部と、架橋剤(酸化亜鉛) 1 0 部と、チオウレア系架橋促進剤 (三新化学社製、サンセラー22C) 3部とを配合し、3本ロールを用いて混練した後、 これらを溶剤(MEK)300部および溶剤(トルエン)150部に溶解して、組成物( コーティング液)を調製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板 上に塗布した後、150℃にて30分間加熱架橋して、厚み100μmの導電性塗膜を作 製した。

[0074]

【組成物B】

分子構造中にスルホン酸基を有しないバインダーポリマーである、カーボネート系TPU (日本ミラクトラン社製、E980) 100部を、溶剤 (MEK) 200部および溶剤 ( テトラヒドロフラン)300部に溶解させた後、これに導電剤であるアセチレンブラック (電気化学工業社製、デンカブラックHS100) 7部を配合し、3本ロールを用いて混 練して組成物を調製した。そして、これを150℃にて30分間加熱架橋して、SUS3 O4板上に厚み100μmの導電性塗膜を作製した。

[0075]

【組成物C】

アセチレンブラックの配合割合を20部に変更する以外は、組成物Bと同様にして、導電 性塗膜を作製した。

[0076]

【組成物D】

カーボンブラックを分散させたシリコーン(信越化学工業社製、KE1350AB)をS U S 3 0 4 板上にプレス成型 ( 1 5 0 ℃× 1 0 分) して、厚み 1 0 0 μ m の 導電性 塗膜を 作製した。

[0077]

【組成物E】

特開平5-88506号公報に記載の実施例1に準じて、導電性塗膜を作製した。すなわ ち、アニリン O. 4 m o 1 / 1 と、硫酸 1. 0 m o 1 / 1 と、過硫酸アンモニウム O. 5 mol/lとを含む水溶液を調製し、化学酸化重合法によりポリアニリンを重合した。得 られたポリアニリンを水酸化ナトリウムで中性に調整した後、水洗し、乾燥して、粒子径 約1μmのポリニリン粉末を得た。つぎに、分子構造中にスルホン酸基を有しないバイン ダーポリマーである、可溶性ナイロン50部を、溶剤(メタノール)500部に溶解させ 、これに上記ポリアニリン粉末50部を添加し、レッドデビルで混合して組成物(コーテ ィング液)を調製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗 布した後、150℃にて30分間加熱架橋して、厚み100μmの導電性塗膜を作製した

[0078]

【組成物F】

特開2001-324882号公報に記載の実施例1に準じて、導電性塗膜を作製した。 すなわち、乾燥したフッ化処理カーボンブラック(ALLIED社製、ACCUFLVO R2028)を、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)中に所定量配合し、ボールミル を用いて室温で6時間混合した。ついで、このカーボンブラック分散NMP液に、3,3

20

30

40

, 4, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 (BPDA) 294. 2gと、p-フェニレンジアミン(PDA)108.2gとを溶解し、窒素雰囲気において、室温で4 時間攪拌しながら反応させ、フッ化処理カーボンブラック入りポリアミド酸溶液を得た。 また、NMP200gに、ポリアニリン粉末20gを添加し、オートホモミキサーを用い て5000гpmで1時間攪拌して溶解させ、10重量%濃度の脱ドープ状態のポリアニ リン溶液を得た。ついで、上記フッ化処理カーボンブラック入りポリアミド酸溶液に、所 定量のポリアニリン溶液を添加した後、攪拌羽根を用いて室温で1時間攪拌し、所望配合 量のフッ化処理カーボンブラック、ポリアニリン入りポリアミド酸溶液(樹脂:ポリアニ リン:フッ化処理カーボンブラック=74重量%:15重量%:11重量%)を得た。そ して、この溶液をSUS304板上に塗布した後、150℃にて30分間加熱架橋して2 00℃まで2℃/分の昇温温度で昇温し、さらに200℃で30分加熱して、厚み100 μmの導電性塗膜を作製した。

# [0079]

### 【組成物G】

特開2002-167519号公報に記載の実施例に準じて、導電性塗膜を作製した。す なわち、アニリン1molと、界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸)〔スルホン酸 基当量:326〕1molとを、水溶液化した酸化剤(過硫酸アンモニウム)1molを 滴下しながら酸化重合させ、界面活性剤構造を有するポリアニリンを得た。つぎに、分子 構造中にスルホン酸基を有しないバインダーポリマーである、ポリエステル(アジペート ) 系 T P U (三井武田ケミカル社製、エラストラン 1 0 4 0 ) 8 0 部を、溶剤 (M E K) 200部および溶剤(トルエン)400部に溶解した後、上記界面活性剤構造を有するポ リアニリン20部を加え、3本ロールを用いて混練し、導電性組成物(コーティング液) を調製した。そして、この組成物(コーティング液)をSUS304板上に塗布して、厚 み100μmの導電性塗膜を作製した。

# [0080]

このようにして得られた導電性塗膜を用いて、下記の基準に従い、各特性の評価を行った 。これらの結果を、後記の表1~表5に併せて示した。

### [0081]

### 〔凝集物の面積〕

各導電性塗膜の、バインダーポリマー中に存在する導電性ポリマーの粒径(メジアン径) を、5~8μmの膜厚のフィルムを3000倍に拡大観察(光学顕微鏡)して測定した。 そして、粒径が1μm以上の凝集物が、塗膜全体に占める割合(面積)を測定した。

### [0082]

# [電気抵抗、電気抵抗の電圧依存性]

各導電性塗膜について、25℃×50%RHの環境下、1Vの電圧を印加した時の電気抵 抗 (Rv=1V) と、133Vの電圧を印加した時の電気抵抗 (Rv=133V) を、S RIS 2304に準じてそれぞれ測定した。そして、Log(Rv=1V/Rv=13 3 V) により、電気抵抗の電圧依存性を変動桁数で表示した。

### [0083]

### [電気抵抗の環境依存性]

各導電性塗膜について、印加電圧10Vの条件下、低温低湿(15℃×10%RH)時の 電気抵抗 (R v = 1 5 ℃×1 0 % R H) と、高温高湿 (3 5 ℃×8 5 % R H) 時の電気抵 抗 (Rv=35℃×85%RH) を、SRIS 2304に準じてそれぞれ測定した。そ して、Log (Rv=15℃×10%RH/Rv=35℃×85%RH) により、電気抵 抗の環境依存性を変動桁数で表示した。

### [0084]

# [環境による電気抵抗変動]

各導電性塗膜について、50℃×95%RHの環境下で30日間放置後の電気抵抗を、S R I S 2 3 0 4 に準じて、 2 5 ℃× 5 0 % R H の環境下で、 1 0 V 印加で測定した ( R v = 3 0 日)。そして、Log(R v = 3 0 日 / R v = 0 日)により、環境による電気抵

20

10

30

40

抗変動を変動桁数で表示した。

[0085]

[高電圧領域での電気抵抗変動 (チャージアップ)]

各導電性塗膜について、 $25\% \times 50\%$  R H の環境下、300 V の電圧を印加した時の電気抵抗(R v = 300 V)を、S R I S 2 3 0 4 に準じて測定した。そして、L o g(R v = 30 V / R v = 30 V /

[0086]

【表1】

			組	月	<b>ķ</b>	物	
		1	2	3	4	5	6
凝集物の面積(%)		3. 1	1. 9	0. 5 5	0. 8 4	1. 0 5	0. 4 8
1 V 電気抵抗		3. 0 0 ×10 <sup>7</sup>	6. 3 0 ×10 <sup>†</sup>	1. 2 0 ×10 <sup>8</sup>	8. 0 0 ×10 <sup>7</sup>	7. 5 0 ×10 <sup>7</sup>	9. 2 0 ×10 <sup>†</sup>
(Ω · c m)	1 3 3 V	1. 2 0 ×10°	3. 9 0 ×10 <sup>7</sup>	1. 1 0 ×10 <sup>8</sup>	6. 0 0 ×10 <sup>7</sup>	5. 5 0 ×10 <sup>7</sup>	6. 5 0 ×10 <sup>†</sup>
電気抵抗の電気	王依存性	0. 4 0	0. 2 1	0. 0 4	0. 1 2	0. 1 3	0. 1 5
電気抵抗の環境依存性 (桁)		0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 4	0.4
環境による電気抵抗変 動(桁)		0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 6	0. 5
チャージアップ (桁)		0. 2 5	0. 1 8	0. 0 9	0. 1 2	0. 1 5	0. 0 8

20

10

30

【0087】 【表2】

			組	成		物	
		7	8	9	1 0	1 1	1 2
凝集物の面積	(%)	1. 1 1	0. 7 7	0. 6 3	2. 1	2. 8	0. 0 8
電気抵抗	1 V	3. 2 0 ×10 <sup>7</sup>	9. 5 0 ×10 <sup>6</sup>	2. 3 0 ×10 <sup>8</sup>	3. 1 0 ×10 <sup>7</sup>	6. 6 0 ×10 <sup>†</sup>	8. 4 0 ×10 <sup>8</sup>
(Ω • c m)	1 3 3 V	2. 4 0 ×10 <sup>†</sup>	8. 2 0 ×10 <sup>8</sup>	1. 3 0 ×10 <sup>8</sup>	1. 7 0 ×10°	4. 4 0 ×10 <sup>7</sup>	8. 3. 0 ×10 <sup>8</sup>
電気抵抗の電気	王依存性	0. 1 2	0. 0 6	0. 2 5	0. 2 6	0. 1 8	0. 0 1
電気抵抗の環 (桁)	境依存性	0. 4	0. 4	0. 5	0. 2	0. 2	0.85
環境による電動(桁)	気抵抗変	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0.4	0. 9
チャージアッ	プ (桁)	0. 2 5	0. 1 2	0. 0 8	0. 3 1	0. 3 5	0. 0 1

【0088】 【表3】

			紐	1	л	Ì.	4	勿	1 6 4. 8 * 1. 1 0 ×10 <sup>7</sup> 9. 0 0 ×10 <sup>6</sup> 0. 0 9		
		1	3	1	4	1	5	1	6		
凝集物の面積	(%)	2.	8	0. 3	9	0.	4 2	4.	8		
電気抵抗	1 V	1. 3 ×1		6. 5 ×1			5 0 10°				
(Ω · c m)	1 3 3 V	8. 5 ×1		4. 5 ×1	010		1 0 10 <sup>8</sup>				
電気抵抗の電子 (桁)	王依存性	0.	1 8	0.	1 6	0.	0 5	0.	0 9		
電気抵抗の環(桁)	竟依存性	0.	3	0.	7	0	. 3	0	. 3		
環境による電動(桁)	環境による電気抵抗変動(桁)				6	0	. 6	0	. 6		
チャージアッ	チャージアップ (桁)				0 5	0	. 0 8	0.	. 1 2		

\*アセチレンブラックを含有するため、凝集物の面積割合が高くなったものと思われる。

10

20

30

【0089】 【表4】

			組	成	物	
		A	В	С	D	E
凝集物の面積	(%)	1. 9	4. 3	9. 8	1 8. 2	2 9. 6
電気抵抗	1 V	3. 5 0 ×10 <sup>1</sup>	4. 0 0 ×10 <sup>10</sup>	1. 6 0 ×10 <sup>6</sup>	4. 5 0 ×10 <sup>4</sup>	6. 8 0 ×10°
(Ω • c m)	1 3 3 V	2. 3 0 ×10 <sup>7</sup>	1. 8 0 ×10 <sup>8</sup>	5. 1 0 ×10 <sup>4</sup>	3. 8 0 ×10 <sup>3</sup>	2. 3 0 ×10 <sup>7</sup>
電気抵抗の電力	王依存性	0. 1 8	2. 3 5	1. 5 0	1.07	2. 4 7
電気抵抗の環 (桁)	竟依存性	2. 3	0. 3	0. 0 3	0.03	0. 3
環境による電動(桁)	気抵抗変	0. 3	0.4	0. 3	0. 2	0. 7
チャージアッ	プ (桁)	2. 3	0. 0 5	0.08	0. 1 3	0. 1 8

【0090】 【表5】

		組	成	ζ <sup>1</sup>	勿
		F		G	
凝集物の面積	(%)	4.	8	2 6.	8
電気抵抗	1 V	9. 0 ×10		1. 0 ×10	
(Ω · c m)	1 3 3 V	2. 0 ×10		6. 5 ×10	
電気抵抗の電子(桁)	王依存性	1. 6	5	0. 2	0
電気抵抗の環境	竟依存性	0.	3	0.	3
環境による電動(桁)	気抵抗変	0.	5	0.	5
チャージアッ	プ (桁)	1.	7	1.	5

30

20

10

40

50

[0091]

上記表の結果から、組成物1~16は、分子構造中にスルホン酸基を有する界面活性剤を 用いて形成した特定の導電性ポリマーと、分子構造中にスルホン酸基を有するバインダー ポリマーとを併用しているため、両者の相溶性が良好で、凝集物の発生を抑制でき、高電 圧領域での電気抵抗の上昇(チャージアップ)が非常に小さかった。また、電気抵抗の電 圧依存性および電気抵抗の環境依存性の双方の特性に優れ、環境による電気抵抗変動も小 さかった。

## [0092]

これに対して、組成物Aは、イオン導電剤を用いているため、電気抵抗の環境依存性が劣 り、高電圧領域での電気抵抗の上昇が大きかった。組成物B,C,Dは、電子導電剤を用 いているため、電気抵抗の電圧依存性が劣っていた。組成物Eは、ポリアニリンとナイロ ンの相溶性が悪く、凝集物が多く発生するとともに、電気抵抗の電圧依存性に劣っていた 。組成物Fは、ポリアニリンと、フッ化処理カーボンブラックとの相溶性が悪く、凝集物 が多量に発生するため、高電圧領域での電気抵抗変動が大きかった。組成物Gは、分子構 造中にスルホン酸基を有しないバインダーポリマーを用いているため、界面活性剤構造を 有する導電性ポリマーとの相溶性が劣り、凝集物が発生し、高電圧領域での電気抵抗の上 昇傾向がみられた。

[0093]

つぎに、本発明に係る電子写真機器部材の実施例について、比較例と併せて説明する。

[0094]

【実施例1】

[現像ロールの作製]

軸体である芯金(直径10mm、SUS304製)をセットした射出成形用金型内に、カ ーボンブラックを分散させたシリコーン(信越化学工業社製、KE1350AB)〔組成 物D〕を注型し、150℃×45分の条件で加熱した後、脱型して、軸体の外周面に沿っ てベース層を形成した。そして、このベース層の表面をコロナ放電処理(条件: O. 3 k W×20秒)した。ついで、前記で調製した組成物Cを上記ベース層の外周面に塗布して 、中間層を形成した。さらに、上記中間層の表面に、前記で調製した組成物1からなる表 層を形成し、軸体の外周面にベース層が形成され、その外周面に中間層が形成され、 さら にその外周面に表層が形成されてなる現像ロールを作製した。

[0095]

【実施例2~18、比較例1~5】

ベース層用材料、中間層用材料および表層用材料として、後記の表6~表9に示す組成物 を用いる以外は、実施例1と同様にして、現像ロールを作製した。なお、ベース層、中間 層もしくは表層を形成していないものについては、「-」と表示した。

[0096]

このようにして得られた実施例品および比較例品の現像ロールを用いて、下記の基準に従 い、各特性の評価を行った。これらの結果を、後記の表6~表9に併せて示した。

[0097]

[電気抵抗、電気抵抗の電圧依存性]

現像ロールの表面をSUS板に押し当てた状態で、現像ロールの両端に各1kgの荷重を かけ、現像ロールの芯金と、SUS板に押し当てた現像ロール表面との間の電気抵抗を、 SRIS 2304に準じて測定した。なお、電気抵抗は、25℃×50%RHの環境下 、1Vの電圧を印加した時の電気抵抗(Rv=1V)と、133Vの電圧を印加した時の 電気抵抗 (R v = 1 3 3 V) をそれぞれ測定した。そして、L o g (R v = 1 V / R v = 133V)により、電気抵抗の電圧依存性を変動桁数で表示した。

[0098]

[電気抵抗の環境依存性]

上記電気抵抗の評価に準じて、印加電圧10Vの条件下、低温低湿(15℃×10%RH ) の時の電気抵抗 (R v = 1 5 ℃×1 0 % R H) と、高温高湿 (3 5 ℃×8 5 % R H) の 時の電気抵抗 (R v = 3 5 ℃ × 8 5 % R H ) を、S R I S 2 3 0 4 に準じてそれぞれ測

10

20

30

40

定した。そして、Log(R v = 1 5 ℃×1 0 % R H / R v = 3 5 ℃×8 5 % R H) によ り、電気抵抗の環境依存性を変動桁数で表示した。

[0099]

〔硬度(JIS A)〕

各現像ロールの最表面の硬度を、JIS K 6253に準じて測定した。

[0100]

〔圧縮永久歪み〕

各現像ロールの圧縮永久歪みを、温度70℃、試験時間22時間、圧縮率25%の条件下 K 6262に準じて測定した。

[0101]

[現像ロール特性]

(画像ムラ)

各現像ロールを市販のカラープリンターに組み込み、20℃×50%RHの環境下におい て画像出しを行った。評価は、ハーフトーン画像での濃度ムラがなく、細線のとぎれや色 ムラがなかったものを○、濃度ムラが生じたものを×とした。

[0102]

(環境による画質の変動)

各現像ロールを市販のカラープリンターに組み込み、15℃×10%RHの環境下におい て画像出しを行った時と、35℃×85%RHの環境下において画像出しを行った時の、 環境による画質の変動の評価を行った。評価は、べた黒画像を印刷し、マクベス濃度計で 変化が 0 . 1以下の時を○、 0 . 1を超える時を×とした。

[0103]

[チャージアップによる濃度変動]

各現像ロールを市販のカラープリンターに組み込み、25℃×50%RHの環境下、30 0 Vの電圧を印加して画像出しを行った。評価は、ハーフトーン画像での濃度ムラがなく 、細線のとぎれや色ムラがなかったものを○、濃度ムラが生じたものを×とした。

[0104]

〔環境による電気抵抗経時変化〕

上記電気抵抗の評価に準じて、50℃×95%RHの環境下で30日間放置後の電気抵抗 を、SRIS 2304に準じて、25℃×50%RHの環境下で10V印加で測定した (Rv=30日)。そして、Log(Rv=30日/Rv=0日)により、環境による電 気抵抗経時変化を変動桁数で表示した。

[0105]

【実施例19~22、比較例6~8】

[帯電ロールの作製]

ベース層用材料、中間層用材料もしくは表層用材料として、後記の表10および表11に 示す組成物を用いる以外は、実施例1の現像ロールの製法に準じて、帯電ロールを作製し た。なお、ベース層、中間層もしくは表層を形成していないものについては、「-」と表 示した。

[0106]

【実施例23、比較例9】

[転写ロールの作製]

ベース層用材料、中間層用材料もしくは表層用材料として、後記の表12に示す組成物を 用いる以外は、実施例1の現像ロールの製法に準じて、転写ロールを作製した。なお、べ ース層、中間層もしくは表層を形成していないものについては、「-」と表示した。

[0107]

【実施例24,25、比較例10】

[転写ベルトの作製]

ベース層用材料、中間層用材料もしくは表層用材料として、後記の表13に示す組成物を 用いる以外は、実施例1の現像ロールの製法に準じて、単層もしくは多層構造の中間転写

10

20

40

ベルト(無端ベルト)を作製した。なお、ベース層、中間層もしくは表層を形成していな いものについては、「-」と表示した。

このようにして得られた実施例品および比較例品の帯電ロール、転写ロール、転写ベルト を用いて、前記現像ロールの特性評価の基準に準じて、各特性の評価を行った。これらの 結果を、後記の表10~表13に併せて示した。なお、転写ベルトの電気抵抗は、転写ベ ルトの内部に直径10mm、重さ1kgのSUS棒を載せ、このSUS棒に接する部分と 、SUS板との間の電気抵抗を、SRIS 2304に準じて測定した。

[0109]

【表 6】

				実	加	É	例	
			1	2	3	4	5	6
表層	組成物	勿番号	1	2	3	4	5	6
衣 僧	厚み	(μm)	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2
中間層	組成物	勿番号	С	С	С	С	С	С
十十月月	厚み (μm)		5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0
ベース 層	組成物	勿番号	D	D	D	D	D	D
眉	厚み (mm)		4	4	4	4	4	4
<b>建</b>	<u>.</u>	1 V	1. 2 4 ×10 <sup>5</sup>	2. 0 3 ×10 <sup>5</sup>	3. 4 0 ×10 <sup>5</sup>	2. 4 4 ×10 <sup>5</sup>	2. 3 2 ×10 <sup>5</sup>	2. 7 3 ×10 <sup>5</sup>
	л.	1 3 3 V	3. 2. 4 ×10 <sup>4</sup>	9. 7 2 ×10 <sup>4</sup>	2. 6 8 ×10 <sup>5</sup>	1. 4 8 ×10 <sup>5</sup>	1. 3 6 ×10 <sup>5</sup>	1. 6 0 ×10 <sup>5</sup>
電気抵抗(桁)	元の電圧	王依存性	0. 5 8	0. 3 2	0. 1 0	0. 2 2	0. 2 3	0. 2 3
電気抵抗(桁)	元の環	竟依存性	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 1	0. 2
硬度(、	JIS	A)	2 8	2 8	2 8	2 9	2 8	2 8
圧縮永久	久歪み	(%)	7	7	7	8	8	8
現像口	- 画	象ムラ	0	0	0	0	0	0
1014日	ル特性 環境による 画質の変動		0	0	0	0	0	0
	チャージアップによる 濃度変動		0	0	0	0	0	0
	環境による電気抵抗経時変化(桁)		0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5

20

30

40

【 0 1 1 0 】 【表 7 】

						実		旅	î			例												
				7		8		9	1	0	1		1	1	2									
	組成	物	番号	7		8		9	1	0	1		1	_1	. 2									
表層	厚み	٠ (	(μm)	1 2		5 0		5 0		1 6		5	0		5 0									
	組成物番号									-														
中間層	厚み (μm)									-														
ベース	組成物番号		D		D		D		D		D			D										
層	厚み (mm)		(mm)	4		4		4		4		4		1	4	_								
	1 V		1. 1 3 ×10 <sup>5</sup>		1. 3 1 ×10 <sup>5</sup>		2. 3 4 ×10 <sup>8</sup>		1. 3 5 ×10 <sup>5</sup>	1	6. 9 × 1(	6 ) <sup>5</sup>		8. 4 ×10	4									
電気抵(Ω)	電気抵抗 (Ω) 133 V			6. 0 6 ×10 <sup>4</sup>		8. 5 0 ×10 <sup>4</sup>		1. 3 0 ×10 <sup>8</sup>	5. 7 4 ×10 <sup>5</sup>			4. 4.3 ×10 <sup>5</sup>			8. 3 ×10	0								
電気抵	抗の	配	E依存性	0. 2 7		0. 1 9		0. 2 5		0. 3 7		0. 2	0		0. 0	1								
電気抵	抗の	環	竟依存性	0. 2		0. 1		0. 1		0. 2		0.	2		0									
硬度	(J I	S	A)	2 6		2 5		2 5		2 6			2 4		2	4								
圧縮永	<b>久歪</b>	巨み (%)		至み (%)		7		6		6		6			5		6							
現像口		画	像ムラ	0		0		0		0		(	<u>C</u>		C	)								
ル特性	ル特性 環境による 画質の変動		境による質の変動	0		0		0		0			0		0		0		0		0		C	) 
	チャージアップによる		0		0		0		0			O 			)									
環境は時変化	環境による電気抵抗経時変化(桁)				5	0. 5	5	0.	5	0. 5	5	0	•	5	0.	5								

20

30

【0111】 【表8】

				実	ħ	包	例	
			1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8
表層	組成	物番号	1 3	1 4	1 5	1 6	С	·
<b>双</b> 眉	厚み	(μm)	5 0	5 0	5 0	1 2	1 2	
中間層	組成	物番号				С	1 4	9
Linke	厚み (μm)					5 0	100	4000
ベース 層			D	D	D	D	D	
/日	厚み (mm)		4	4	4	4	4	
電気抵抗	<del>L</del>	1 V	1. 6 6 ×10 <sup>5</sup>	6. 5 0 ×10 <sup>8</sup>	7. 1 0 ×10 <sup>4</sup>	7. 8 4 ×10 <sup>4</sup>	1. 3 0 ×10°	1. 8 4 ×10 <sup>8</sup>
(Ω)	'u	1 3 3 V	8. 8 0 ×10 <sup>4</sup>	4. 5 0 ×10 <sup>8</sup>	3. 4 0 ×10 <sup>4</sup>	2. 5 2 ×10 <sup>4</sup>	9. 0 0 ×10 <sup>8</sup>	1. 0 4 ×10 <sup>8</sup>
電気抵抗(桁)	で配	<b>E依存性</b>	0. 2 8	0. 1 6	0. 3 2	0.49	0. 1 6	0. 2 5
電気抵抗(桁)	元の環	竟依存性	0. 5 4	0. 1	0. 1	0. 2	0. 3	0. 3
硬度(」	IS	A)	2 4	2 4	2 6	7 3	2 7	8 1
圧縮永久	である	(%)	6	6	6	1 4	6	9
現像ロール特性	- 画	象ムラ	0	0	0	0	0	0
		境による 質の変動	0	0	0	0	0	0
チャーシ濃度変更	チャージアップによる 濃度変動		0	0	0	0	0	0
	環境による電気抵抗経 時変化 (桁)		0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6

【0112】 【表9】 10

20

30

				比	較	例	
			1	2	3	4	5
	組成	勿番号	В	В	Е	F	G
表層	厚み	(μm)	5 0	1 2	1 2	1 2	1 5
.Leefe	組成	物番号		A	С		С
中間層	厚み	(μm)		5 0	5 0		5 0
ベース	組成	物番号	D	D	D	D	D
層	厚み	(mm)	4	4	4	4	4
and the same of th		1 V	4. 0 0 ×10 <sup>8</sup>	5. 5 4 ×10 <sup>9</sup>	1. 6 4 ×10 <sup>7</sup>	2. 1 6 ×10 <sup>8</sup>	8. 2 6 ×10 <sup>4</sup>
	電気抵抗 (Ω) 133 V		1.80 ×10 <sup>6</sup>	1. 9 1 ×10 <sup>7</sup>	5. 8 8 ×10 <sup>4</sup>	4. 8 0 ×10 <sup>6</sup>	2. 3 1 ×10 <sup>4</sup>
電気抵(桁)	抗の電	圧依存性	2.35	2. 4 6	2. 4 5	1. 6 5	0. 5 5
電気抵(桁)	抗の環	境依存性	0. 3	1. 4	0. 3	1. 0 2	0. 5
硬度(	JIS	A)	2 4	2 7	2 8	2 7	2 7
圧縮永	久歪み	(%)	6	6	6	6	6
現像口		像ムラ	×	×	×	×	0
ル付任	ル特性 環境による 画質の変動		0	×	0	0	0
	チャージアップによる 濃度変動			×	0	×	×
環境に時変化	環境による電気抵抗経 時変化(桁)			0. 3	0. 5	0. 5	0. 7

20

30

【0113】 【表10】

				5	Ę		施			例		
			1	9	2	2 0		2	1	:	2	2
	組成物	潘号		1		1 (		(	C			_ ]
表層	厚み	(μm)		5 0		2 (	)		6			
	組成物	勿番号	-			С		1	1			
中間層	厚み	(μm)	-			5	0		5 0			_
ベース	組成	勿番号		D		D			D		1	1
層	厚み	(mm)		3		3			3		:	3
	1 V		2. ×	2 6 10 <sup>5</sup>		2. 9 ×10	2		2 10°		6. 8 ×1	3 3 01 °
電気抵  (Ω)	<u>ī</u> ī.	1 3 3 V	3. ×	3. 2 6 1. 2 4 ×10 <sup>4</sup> ×10 <sup>5</sup>			7 10		4. 7 3 ×10 <sup>1 0</sup>			
電気抵(桁)	抗の電	圧依存性	0	. 8 4		0. 3	7	0	. 1	9	0.	1 6
電気抵(桁)	抗の環	境依存性	(	). 3		0.	3	C	).	3	0.	3
硬度(	JIS	A)		2 8	3	2 8		2 9		9		8 5
圧縮永	久歪み	(%)		6		6			7			9
帯電口		像ムラ		0		C	)_		С	)	_	0_
ル特性	ル特性 環境による 画質の変更			0			)		C	)		0
	チャージアップによる		5	0			)			)		0
環境的時変化	環境による電気抵抗時変化(桁)			0.	5	0.	5		0.	5	0	. 5

20

30

40

【0114】 【表11】

					比		較		例	
					6		7		8	
	組成	物	番号		E		В		F	
表 層	厚み	٠ (	μm)		5 0		1 (	)	1 4	
	組成	沈物	番号				Α			
中間層	厚み	٠ بز	(μm)	-			5	0		
ベース	組页	文	潘号		D D				D	
層	厚。	<u></u>	(mm)		3		3		3	
	<del></del>		1 V	1 >	1. 1 9 1. ×10 <sup>8</sup> ×			1 8	4. 4 ×10 <sup>8</sup>	
電気抵(Ω)	抗	1 3 V			1. 0 ×10'	8	1. 1 ×10	6	3. 5 ×10 <sup>7</sup>	0
電気抵(桁)	抗の	電	王依存性	1	2. 4	7	2. 0	8	1. 1	0
電気扱	抗の	環	竟依存性		0.	3	1.	4	1. 0	2
硬度	(J I	S	A)	1	2	6	2	8	2	
圧縮え	<b>人</b> 在	み	(%)	1	6		6	3	6	
帯電口		圃	像ムラ	1	×		>	<	×	
ル特性	E				C	)	,	Κ	С	)
	チャージアップによ <i>濃度変</i> 動					)	×		×	:
環境的時変	こよる 比(*	る電行)	気抵抗約	圣	0.	5	0.	3	0.	5

20

30

【 0 1 1 5 】 【 表 1 2 】

		実施例 2 3		比較例 9			
表層	組成物番号		1	1	E		
	厚み	2 0		5 0			
中間層	組成物番号		С				
	厚み	5 0					
ベース 層	組成物番号		D		D		
眉	厚み (mm)		6		6		
電気抵抗 (Ω)		1 V	5. 8 5 ×10 <sup>5</sup>		5. 1 0 ×10 <sup>τ</sup>		
		1 3 3 V	3. 1. 7 ×10 <sup>5</sup>		1. 7 6 ×10 <sup>5</sup>		
電気抵抗の電圧依存性(桁)			0. 2 7		2. 4 6		
電気抵抗の環境依存性 (桁)			0.	3	0.	3	
硬度 (JIS A)		2 6		2	4		
圧縮永久歪み (%)			6		6		
転写ロ- ル特性	- 画修	画像ムラ		0		×	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	環境による 画質の変動		0		0		
チャージアップによる 濃度変動			0		0		
環境による電気抵抗経 時変化 (桁)			0.	5	0.	5	

【 0 1 1 6 】 【 表 1 3 】 10

20

			_						٦.
			実 施		<u> </u>	例	比較例		
		-	2	4	2	5	1	0	
<b></b> =	組成物番号				1	1			
表層	厚み (μm)					3			
1.00=	組成物番号		1	0	1	4	F		
中間層	厚み (μm)		250			1 0		8 0	
ベース 組成物		7番号	_			С			
層	厚み (mm)		_			0. 2 5			
電気抵抗(Ω)		1 V		6 3 10 <sup>8</sup>	2	2 2 8 < 10 <sup>8</sup>	3. 6 0 ×10 <sup>10</sup>		•
		1 3 3 V	1. ×	1. 0 5 ×10 <sup>6</sup>		L. 5 8 ×10 <sup>8</sup>	8. ×	8. 0 0 ×10 <sup>8</sup>	
電気抵抗の電圧依存性(桁)			0.	0. 4 0 0.		). 1 6 1. 6		. 6 !	ō
電気抵抗の環境依存性(桁)			0	. 3		0. 3			3
硬度 (JIS A)			-						
圧縮永久歪み (%)									
転写介	い画	像ムラ		0		0		×	
卜特性	環	環境による画質の変動		0		0		0	
チャージアップによる 濃度変動			3	0		0		×	
環境による電気抵抗経 時変化(桁)			¥	0.	5	0.	5	0.	5

20

30

[0117] 上記結果から、すべての実施例品は、電子写真機器部材の構成層の少なくとも一部に、本 発明の半導電性組成物(組成物1~16)を用いているため、現像ロール特性、帯電ロー ル特性、転写ロール特性、転写ベルト特性に優れていた。

### [0118]

これに対して、比較例品は、電気抵抗の電圧依存性や電気抵抗の環境依存性に劣る組成物 (組成物 A ~ G のいずれか)のみを用いているため、現像ロール特性、帯電ロール特性、 転写ロール特性、転写ベルト特性に劣っていた。

# [0119]

### 【発明の効果】

以上のように、本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物は、分子構造中にスルホン酸

基を有する界面活性剤を用いて、界面活性剤構造を有する導電性ポリマーを形成し、この導電性ポリマー(A 成分)とともに、分子構造中に、スルホン酸基およびスルホン酸金属塩構造の少なくとも一方を有するバインダーポリマー(B 成分)を併用するものである。そのため、両者の相溶性が良好となり、凝集物の発生を抑制でき、高電圧領域での電気抵抗の上昇が小さくなるとともに、電気抵抗の電圧依存性および電気抵抗の環境依存性の双方の特性に優れるという効果を奏する。

[0120]

また、バインダーポリマー(B成分)として、アクリル系樹脂等の特定のポリマーを用いたり、もしくはバインダーポリマー(B成分)中における、スルホン酸基量を特定の範囲に設定すると、A成分とB成分との相溶性がさらに向上するようになる。

[0121]

また、A成分の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、分子構造中にスルホン酸基を有し、かつ、ナフタレン構造およびアントラセン構造の少なくとも一方を有するか、もしくはこれらが特定の置換基を備えているか、A成分の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤が、前記の一般式(1)で表されるものであると、A成分とB成分との相溶性がさらに向上するようになる。しかも、A成分の界面活性剤構造を形成するために用いられる界面活性剤中のスルホン酸基当量が、特定の範囲内に設定されていると、A成分とB成分との相溶性がより一層向上するようになる。

[0122]

また、本発明の電子写真機器部材用半導電性組成物を、電子写真機器部材の少なくとも一部に用いると、この半導電性組成物に特有な効果を備えた電子写真機器部材を得ることができる。すなわち、本発明の半導電性組成物を、電子写真機器部材の構成層の少なくとも一部に用いると、先で述べたような、高電圧領域での電気抵抗の上昇が小さくなり、電気抵抗の電圧依存性および電気抵抗の環境依存性の双方の特性に優れるという、本発明の半導電性組成物の効果が、この半導電性組成物を用いていない他の構成層にも及ぶようになる。その結果、電子写真機器部材全体として、湿熱環境での電気抵抗変動が小さくなるため、良好な画像が得られるという効果を奏する。

# フロントページの続き

F ターム(参考) 3J103 AA02 FA01 FA14 GA57 GA58 GA60 HA02 HA20 HA41 HA43 HA46 HA46 HA48 HA53 4J002 AC011 AC111 BB201 BD171 BG071 BM002 BP011 CD201 CE002 CH072 CH122 CK021 CM012 CM041 CN012 EV236 FD316 GQ00